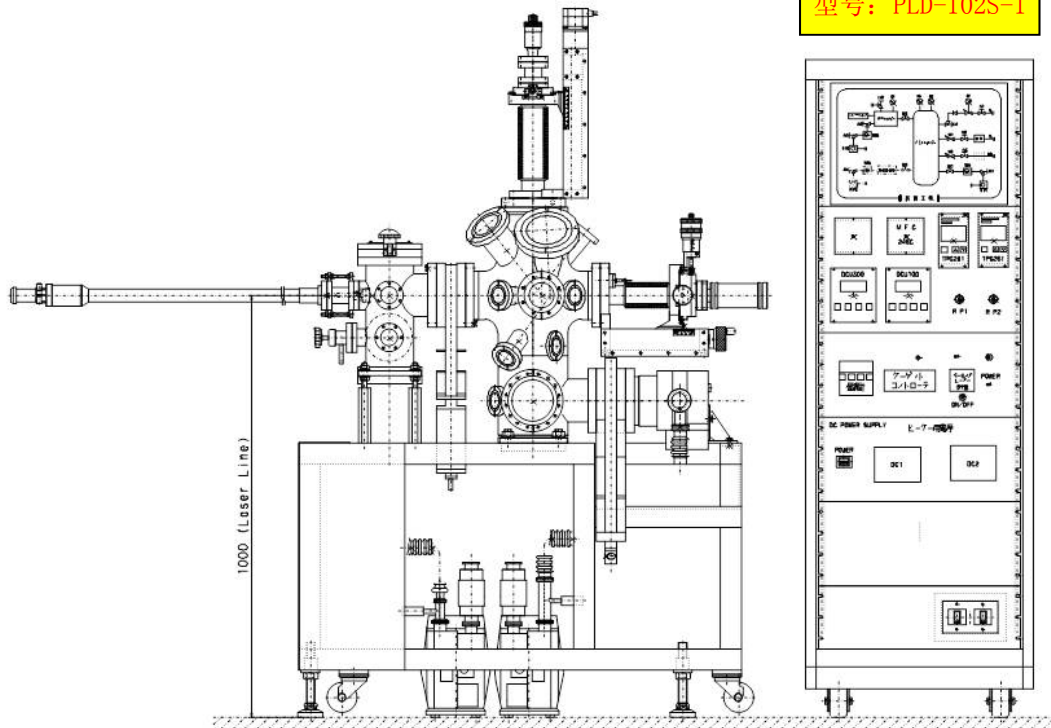


脉冲激光沉积系统

Pulsed Laser Deposition System

型号: PLD-102S-1



设备的详细指标及其它型号欢迎来电咨询

设备名称	脉冲激光沉积系统(Laser MBE Si通电加热)	备注
型号	PLD-102S-1 (镀膜室+准备室+RHEED+镀膜软件)	
概要	镀膜室尺寸: 160 (ID) X550 (H) mm	电解抛光、外缠加热丝
	靶: $\phi 10 \times 5$ mm 5个 (有防污染挡板)	上下可扫描
	衬底加热: Si片通电加热、温度850 度	其它加热形式可选择
	衬底: 10X10mm , 温度高于800, 4轴位移台	根据需要尺寸可以调整
	镀膜室真空度: 低于 5×10^{-6} Pa	可选择抽气方式
	工作气体: 2路, 质量流量计和微量调节阀控制	根据需要可调整
	配置仪器: 准备室, RHEED, 离子源清洗等	根据需要可更改
	选配仪器: RHEED图像处理软件, 膜厚仪等	根据需要选配
尺寸及电源	尺寸: 110 (长) X80 (宽) X180 (高) CM 电源: 单相 220V 50A	

株式会社 アンセイテック ANSEI TECH CO., LTD.
 TEL: 06-6707-5888 E-mail: info@anseitech.com